PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-123987

(43)Date of publication of application: 06.05.1994

(51)Int.CI.

G03G 5/05

G03G 5/00

(21)Application number: 04-235831

(71)Applicant: MITSUBISHI KASEI CORP

(22)Date of filing:

03.09.1992

(72)Inventor: UENAKA TORU

MURAKAMI OSAMU SATO TERUMI

RIN MAMORU

(54) PRODUCTION OF ELECTROPHOTOGRAPHIC SENSITIVE BODY

(57)Abstract:

PURPOSE: To suppress serious defect caused by the bubbles generating at the drying stage of a photosensitive body after coating, to minimize the adverse effect caused by the wear of a film and the accumulation of residual potential and to produce the high quarity electrophotographic sensitive body excellent in printing resistance.

CONSTITUTION: In the production method of the electrophotographic sensitive body having the photosensitive layer with ≥27µm film thickness by applying the coating liq. for forming photosensitive layer on the electrically conductive supporting body and drying it, the coating liq. for forming photosensitive layer containes at least a charge transfer agent, a binder resin and a solvent which is composed of 50-95wt.% a solvent having the b.p. from 35°C to the drying temp. at 1atm. and 50-5wt.% a solvent having the b.p. above the drying temp. at 1atm.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.07.1999

[Date of sending the examiner's decision of

31.10.2000

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3352723

[Date of registration]

20.09.2002

[Number of appeal against examiner's decision of

2000-18897

rejection

[Date of requesting appeal against examiner's

29.11.2000

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-123987

(43)公開日 平成6年(1994)5月6日

| (51)Int.Cl. ⁵ | | 識別記号 | 庁内整理番号 | FI | 技術表示箇所 |
|--------------------------|------|-------|---------|----|--------|
| G 0 3 G | 5/05 | 102 | 9221-2H | | |
| | 5/00 | 1 0 1 | 9221-2H | | |

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

| (01)(1)(85.75.12 | ## PET/ 4 000001 | (71) (1) (72) |
|------------------|------------------|-----------------------|
| (21)出願番号 | 特願平4-235831 | (71)出願人 000005968 |
| | • | 三菱化成株式会社 |
| (22)出願日 | 平成 4年(1992) 9月3日 | 東京都千代田区丸の内二丁目 5番 2号 |
| | | (72)発明者 上中 徹 |
| | | 神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三 |
| | | 菱化成株式会社総合研究所内 |
| | | (72)発明者 村上 修 |
| | | 神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三 |
| | | 菱化成株式会社総合研究所内 |
| | | (72)発明者 佐藤 照美 |
| | | 神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三 |
| | | 菱化成株式会社総合研究所内 |
| | | (74)代理人 弁理士 長谷川 曉司 |
| | | 最終頁に続く |

(54)【発明の名称】 電子写真感光体の製造方法

(57)【要約】

【構成】 感光層形成用塗布液を導電性支持体上に塗布、乾燥して、膜厚27μm以上の感光層を有する電子写真感光体を製造する方法において、感光層形成用塗布液が、少なくとも電荷移動剤、バインダー樹脂及び溶剤を含有し、溶剤が、35℃から該乾燥の温度までの1気圧における沸点を有する溶剤50~95重量%と防らなる電子写真感光体の製造方法。

【効果】 塗布後の感光体の乾燥工程において発生する 泡由来の重大な欠陥を抑制させ、膜の摩耗および残留電 位蓄積に由来する悪影響を最小限に抑え、高品質且つ耐 刷性にすぐれた電子写真感光体を製造できる。 【特許請求の範囲】

【請求項1】 感光層形成用塗布液を導電性支持体上に 塗布、乾燥して、膜厚27μm以上の感光層を有する電 子写真感光体を製造する方法において、該感光層形成用 塗布液が、少なくとも電荷移動剤、バインダー樹脂及び 溶剤を含有し、該溶剤が、35℃から該乾燥の温度まで の1気圧における沸点を有する溶剤50~95重量%と 該乾燥の温度を越える1気圧における沸点を有する溶剤 50~5重量%とからなることを特徴とする電子写真感 光体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子写真感光体の製造方法に関するものである。詳しくは膜厚が27μm以上の感光層を有する耐刷性に優れた電子写真感光体の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】電子写真技術は、即時性、高品質の画像が得られることなどから、近年では複写機の分野にとどまらず、各種プリンターの分野でも広く使われ応用されできている。電子写真技術の中核となる感光体については、その光導電材料として従来からのセレン、ヒ素ーセレン合金、硫化カドミウム、酸化亜鉛といった無機系の光導電体から、最近では、無公害で成膜が容易、製造が容易である等の利点を有する有機系の光導電材料を使用した感光体が開発されている。

【0003】有機系感光体の中でも電荷発生層及び電荷移動層を積層した、いわゆる積層型感光体が考案され研究の主流となっている。積層型感光体は、それぞれ効率の高い電荷発生物質及び電荷移動物質を組合せることに 30より高感度な感光体が得られること、材料の選択範囲が広く安全性の高い感光体が得られること、また塗布の生産性が高く比較的コスト面でも有利なことから、感光体の主流になる可能性も高く鋭意開発されている。通常の積層型感光体においては、電荷発生層は0.5μm程度、電荷移動層は10~20μm程度で設けられている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、現在一般に使用されている積層型感光体はその耐久性においてはまだまだ無機系感光体に劣っており、比較的低級機種に限って使用されているのが現状である。この耐久性が劣る大きな原因の一つとして、電子写真プロセスのクリーニング工程における感光層の摩擦による膜の摩耗が挙げられている。すなわち膜が摩耗することにより帯電電位が下がり画像上のコントラストが低下するためである。

【0005】この様な膜の摩耗を少なくするためには、 感光層表面の耐摩耗性を向上させることが重要である が、一方感光層の膜厚を厚くすることも有力な手段の一 つと考えられる。こうすることにより膜の摩耗の絶対量 50 は同じでも、相対的な膜の摩耗の変化量は小さくなり帯 電電位や感度の変動を少なく抑えることができるためで ある。

【0006】こうした厚膜化により膜の摩耗による帯電電位や感度の変動を抑制することができるが、一方感光体の製造工程での自然乾燥又は強制乾燥時に感光層中に泡が発生する。この泡は、画像上大きな欠陥となると共に感光体の製造歩留りを大きく低下させる。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、感光層形成用塗布液中の溶剤を徐々に蒸発させるために、乾燥時の温度より高い沸点を有する溶剤を感光層形成用塗布液中に適当量混合し、感光層を形成し、乾燥せしめれば、重大な欠陥となる泡の発生を大幅に抑制せしめ、画像および耐刷性に優れた電子写真感光体を容易に製造し得ることを見い出し本発明に到達した。

【0008】即ち、本発明の目的は、高品質且つ耐久性が向上した電子写真感光体を工業的有利に製造することにある。本発明は上述の問題を解決するためになされたものでありその要旨は、感光層形成用塗布液を導電性支持体上に塗布、乾燥して、膜厚27μm以上の感光層を有する電子写真感光体を製造する方法において、該感光層形成用塗布液が、少なくとも電荷移動剤、バインダー樹脂及び溶剤を含有し、該溶剤が、35℃から該乾燥の温度までの1気圧における沸点を有する溶剤50~95重量%と該乾燥の温度を越える1気圧における沸点を有する溶剤50~5重量%からなることを特徴とする電子写真感光体の製造方法に存する。

【0009】以下本発明を詳細に説明する。本発明方法に用いる導電性支持体としては、例えばアルミニウム、ステンレス網、銅、ニッケル等の金属材料、表面にアルミニウム、銅、パラジウム、酸化すず、酸化インジウム等の導電性層を設けたポリエステルフィルム、紙等の絶縁性支持体が挙げられる。なかでもアルミ等の金属のエンドレスパイプが好ましい支持体である。

【0010】導電性支持体と感光層の間には通常使用されているような公知のバリアー層が設けられていてもよい。バリアー層としては、例えばアルミニウム陽極酸化被膜、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム等の無機層、ポリビニルアルコール、カゼイン、ポリビニルピロリドン、ポリアクリル酸、セルロース類、ゼラチン、デンプン、ポリウレタン、ポリイミド、ポリアミド等の有機層が使用される。

【0011】感光層としては、電荷発生物質等の光導電材料粒子がバインダー樹脂、電荷移動物質等からなるマトリックス中に分散されてなる分散型感光層、並びに電荷発生層及び電荷移動層を積層した積層型感光層のいずれでも採用し得る。しかし、本発明は特に膜厚 2.7 μm以上の電荷移動層を有する積層型感光層に有用であるの

2

で、以下、この感光層について説明する。

【0012】電荷発生層に用いられる電荷発生物質としては、セレン及びその合金、ヒ素ーセレン、酸化カドミウム、酸化亜鉛、その他の無機光導電物質、フタロシアニン、アゾ色素、キナクリドン、多環キノン、ピリリウム塩、チアピリリウム塩、インジゴ、チオインジゴ、アントアントロン、ピラントロン、ジアニン等の各種有機額料、染料が使用できる。

【0013】中でも無金属フタロシアニン、銅塩化インジウム、塩化ガリウム、錫、オキシチタニウム、亜鉛、バナジウム等の金属又は、その酸化物、塩化物の配位したフタロシアニン類、モノアゾ、ピスアゾ、トリスアゾ、ポリアゾ類等のアゾ顔料が好ましい。電荷発生層はこれらの物質の均一層或いはバインダー樹脂中に微粒子分散した状態で使用される。

【0014】そのバインダー樹脂としては、ポリビニルアセテート、ポリメタクリル酸エステル、ポリアクリル酸エステル、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール、ポリビニルプロピオナール、ポリビニルブチラール、フェノキシ樹脂、エポキシ樹脂、セルロースエステル、セルロースエーテル、ウレタン樹脂などがある。

【0015】電荷発生層の膜厚としては通常、 0.1μ m~ 1μ m、好ましくは 0.15μ m~ 0.6μ mが好適である。またここで使用される電荷発生物質の含有量は、バインダー樹脂 100 重量部に対して20~300 重量部、好ましくは30~200 重量部の範囲で用いられる。電荷移動層中の電荷移動材料としては、例えばポリビニルカルバゾール、ポリビニルピレン、ポリアセナフチレン等の高分子化合物または各種ピラゾリン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、アミン誘導体等の低分子化合物が使用できる。

【0016】これらの電荷移動材料とともにバインダー樹脂が配合される。好ましいバインダー樹脂としては、例えばポリメチルメタクリレート、ポリ酢酸ビニル、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル等のビニル重合体、およびその共重合体、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスルフォン、ポリエーテル、ポリケトン、フェノキシ、エポキシ、シリコーン樹脂等が挙げられ、またこれらの部分的架橋硬化物も使用される。またこれらの電荷移動材料の含有量は、バインダー樹脂100重量部に対して通常30~200重量部、好ましくは50~150重量部の範囲で用いられる。更に電荷移動層には成膜性、可とう性等を向上するために酸化防止剤、増感剤、レベリング剤等の各種添加剤を含んでいてもよい。電荷移動層の膜厚は27μm以上、より好ましくは30μmから50μmで使用される。

【0017】感光層形成用塗布液としては、少なくとも 電荷移動剤、バインダー樹脂及び溶剤を含有しており、 更に必要に応じて電荷発生物質等の光導電材料粒子、酸化防止剤、増感剤、レベリング剤等を含んでいてもよい。溶剤としては、その沸点(1気圧における値、以下同様)が35℃から塗布後の感光体の乾燥温度までの範囲にある溶剤50~95重量%とその沸点が塗布後の感光体の乾燥温度を越える範囲にある溶剤50~5重量%からなる混合溶剤を用いる。

【0018】乾燥温度が例えば120℃の場合、低沸点

側の溶剤としては例えばベンゼン(沸点80.1℃)、 トルエン (沸点110.6℃) 等の芳香族炭化水素類、 アセトン (沸点56.1℃)、メチルエチルケトン (沸 点79.6℃)、ジエチルケトン (沸点102.0 ℃)、メチルイソブチルケトン (沸点115.9℃) 等 のケトン類、酢酸メチル (沸点57.8℃)、プロピオ ン酸エチル (沸点99.1℃) 等のエステル類、メタノ ール (沸点64.5℃)、エタノール (沸点78.3 ℃)、プロパノール (沸点 97.2℃)、ブタノール (沸点117. 7℃) 等のアルコール類、テトラヒドロ フラン (沸点66℃)、ジオキサン (沸点101.3 ℃)、ジメトキシメタン(沸点42℃)、ジメトキシエ タン (沸点85.2℃) 等のエーテル類、四塩化炭素 (沸点76.8℃)、クロロホルム (沸点61.2 ℃)、塩化メチレン (沸点39.8℃)、ジクロロエタ ン (沸点82℃)、トリクロロエチレン (沸点87.2 ℃) のハロゲン化炭化水素類等がある。これらの溶剤は 単独として、或いは混合して使用しても良い。これらの 溶剤は、特に沸点50~100℃、好ましくは60~9 0℃のものを70~90重量%用いることが好ましい。 【0019】これらの溶剤と共に沸点が120℃を越え る溶剤を少なくとも1種以上使用する。混合割合は5~ 50重量%、好ましくは10~30重量%の範囲で用い られる。その溶剤としては、例えばキシレン (沸点14 0℃) 等の芳香族炭化水素類、シクロヘキサノン (沸点 155.7℃)、シクロペンタノン (沸点130℃)、 ペントキソン (沸点160℃)、アセチルアセトン (沸 点140.6℃) 等のケトン類; エチルセルソルブ (沸 点135℃)、イソプロピルセルソルブ(沸点141 ℃)、アニソール(沸点154℃)等のエーテル類:酢 酸イソペンチル (沸点142℃) 、乳酸メチル (沸点1 44℃)、メチルセルソルブアセテート (沸点144. 5℃)、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセ テート (沸点146℃) 、乳酸エチル (沸点154 ℃)、3-メトキシブチルアセテート(沸点173 ℃)、マロン酸ジメチル(沸点184℃)、コハク酸ジ メチル (沸点195℃)、アセト酢酸メチル (沸点17 0°C) 等のエステル類、N, N-ジメチルホルムアミド (沸点153.0°C)、N, N-ジメチルアセトアミド (沸点166.1℃) 等のアミド類、ジメチルスルホキ シド (沸点189.0℃) 等がある。

【0020】感光層の途布方法としては、スプレー途布

にくくなる。

法、スパイラル塗布法、リング塗布法、浸漬塗布法等が ある。スプレー塗布法としては、エアスプレー、エアレ ススプレー、静電エアスプレー、静電エアレススプレ 一、回転霧化式静電スプレー、ホットスプレー、ホット エアレススプレー等があるが、均一な膜厚を得るための 微粒化度、付着効率等を考えると回転霧化式静電スプレ ーにおいて、再公表平1-805198号に開示されて いる搬送方法、すなわち円筒状ワークを回転させながら その軸方向に間隔を空けることなく連続して搬送するこ とにより、総合的に高い付着効率で膜厚の均一性に優れ 10 た電子写真感光体を得ることができる。

【0021】スパイラル塗布法としては、特開昭52-119651号公報に開示されている注液塗布機または カーテン塗布機を用いた方法、特開平1-231966 号公報に開示されている微小開口部から塗料を筋状に連 続して飛翔させる方法、特開平3-193161号公報 に開示されているマルチノズル体を用いた方法等があ る。

【0022】以下、浸漬塗布法について説明する。上述 した電荷移動剤、バインダー等の材料、溶剤を用いて全 20 固形分濃度が25%以上、より好ましくは25%以上4 0%以下で、かつ粘度が通常50センチポアーズ~30 0センチポアーズ以下、好ましくは100センチポアー ズ~200センチポアーズ以下の感光層形成用塗布液を 調整する。ここで実質的に塗布液の粘度はバインダーポ リマーの種類及びその分子量により決るが、あまり分子 量が低い場合にはポリマー自身の機械的強度が低下する ためこれを損わない程度の分子量を持つバインダーポリ マーを使用することが好ましい。この様にして調整され た塗布液を用いて浸漬塗布法により感光層である電荷移 30 動層が形成される。

【0023】電荷移動層の膜厚は乾燥後に27μm以 上、より好ましくは30μmから50μmとなる様に塗 布速度を調整しなければならない。ここで塗布速度とは 液面に対する被塗布体の引上げ速度のことであり、およ そ30~80 cm/分が適当である。塗布速度がこれよ り遅い場合には非常に生産性が悪くなり、速い場合には 塗布装置の振動等に影響されやすくなり均一な塗膜が得

【0024】その後塗膜を乾燥させ、必要且つ充分な乾 燥が行われる様に乾燥の温度と時間を調整すると良い。 乾燥時温度としては通常、100~250℃、好ましく は110~170℃、さらに好ましくは120~140 ℃の範囲である。ここで乾燥時の温度とは塗布された感 光体の乾燥時の表面温度をいう。低沸点の溶剤の沸点と の温度差が小さければ乾燥には比較的長時間を要する が、感光層中の有効成分が分解・変質する恐れが小さ い。乾燥条件としては上記1段での乾燥条件の他、例え ば2段乾燥の様な方法もとることができる。この場合、 1段目の乾燥温度は50~150℃、好ましくは70~ 120℃、2段目の乾燥温度は1段目より高い温度で通 常、100~250℃、好ましくは110~170℃、 さらに好ましくは120~140℃であって必要且つ充 分な乾燥が行われる様に乾燥時間を調整すると良い。2 段乾燥などの乾燥温度を途中で変更する場合は、乾燥中 の最高温度を基準として、該最高温度より沸点の高い溶 剤と低い溶剤を選択する。

6

【0025】乾燥方法としては、熱風乾燥器、蒸気乾燥 器、赤外線乾燥器及び遠赤外線乾燥機等を用いる。本発 明の方法を用いて作製した電子写真感光体は、電気特性 等に対して悪影響を及ぼさずに欠陥(泡由来)を無くす ことができる。このような欠陥の発生は発光層中の溶剤 が急激に蒸発することによって生じると考えられ、熱容 量の大きな導電性支持体を用いるとより多発するのでこ うした場合に本発明による製造方法を採用することは、 より効果的である。従って、導電性支持体としてアルミ ニウムシリンダーを用いる場合には、肉厚2mm以上の 場合により効果が顕著となる。

[0026]

【実施例】以下本発明を実施例により更に詳細に説明す るが、本発明はその要旨を越えない限り以下の実施例に 限定されるものではない。

実施例1

次式(1)で表わされるビスアゾ化合物10重量部 [0027] 【化1】

$$\begin{array}{c|c}
O & N & O \\
O & N & O \\
O & O & O \\
N = N & O & O \\
O & O & N = N & O
\end{array}$$
(1)

砕分散処理を行なった。ここで得られた顔料分散液をポリビニルブチラール(積水化学工業(株)製、商品名BH-3)の5%ジメトキシエタン溶液に加え、最終的に固形分濃度4.0%の分散液を作製した。

【0029】この様にして得られた分散液に、表面が鏡面仕上げされた外径80mm、長さ340mm、肉厚2.0mmのアルミシリンダーを浸漬塗布し、その乾燥

膜厚が約0. 4μmとなるように電荷発生層を設けた。 次にこのアルミシリンダーを、次式(2)で表わされる ヒドラゾン化合物95重量部と次式(3)で表わされる シアノ化合物1.5重量部

【0030】 【化2】

$$CH = N - N$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$\begin{array}{c|c}
C \ell \\
C \ell \\
\hline
C \ell \\
\hline
C N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C N \\
C N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C N \\
C N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C N \\
C N
\end{array}$$

【0031】及びポリカーボネート樹脂(三菱化成 (株) 製ノバレックス;粘度平均分子量20,300)100重量部を、テトラヒドロフラン (沸点66℃)440重量部、マロン酸ジメチル (沸点184℃)49重量部の混合溶剤に溶解させて得た塗布液 (固形分濃度30%、粘度143センチポアーズ)に浸荷塗布した後、室温で30分放置し、その後熱風恒温乾燥器で感光体表面温度130℃で24分間乾燥させ、乾燥後の膜厚が35μmとなるように電荷移動層を設けた。

【0032】この様に作製した感光体を市販の複写機に 30 装着して、コピー画像を調べたところ泡由来の欠陥のない画像が得られた。結果を表1に示す。また、帯電一露光一除電のみの繰り返しサイクルを60万回行ったところ帯電電位(V。)、残留電位(Vr)、感度(VL)はほとんど変化がなく、繰り返し後のコピー画像もカブリのない良好な画像が得られた。結果を図1に示す。

【0033】ここで、各々の電位の測定法を簡単に説明する。複写機の現像槽を取除き、その部分に電位計センサーをとり付けた。次に複写機の原稿台上に真白な原稿と真黒な原稿を半々に置き、この原稿を複写した際の黒 40地部の電位を帯電電位 (V。)、白地部の電位を感度

 (V_L) として測定した。除電後に残った電位を残留電位 (V_r) として測定した。

【0034】 実施例2

電荷移動層の塗布溶剤をテトラヒドロフラン391重量 部、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート (準点1.4.6%) 0.8 乗品型の調子が関し、たびはな

(沸点146℃) 98重量部の混合溶剤とした以外は、 実施例1と同様に行った。この様に作製した感光体を市 販の複写機に装着して、コピー画像を調べた。実施例1 と同様、泡由来の欠陥のない良好な画像が得られた。結 50 果を表1に示す。繰り返し特性も良好であった。

【0035】実施例3

電荷移動層の塗布溶剤をテトラヒドロフラン391重量部、アニソール(沸点154℃)98重量部の混合溶剤とした以外は、実施例1と同様に行った。この様に作製した感光体を市販の複写機に装着して、コピー画像を調べた。実施例1と同様、泡由来の欠陥のない良好な画像が得られた。結果を表1に示す。繰り返し特性も良好であった。

【0036】 実施例4

電荷移動層の塗布溶剤をテトラヒドロフラン391重量 部、アセチルアセトン(沸点140.6℃)98重量部 の混合溶剤とした以外は、実施例1と同様に行った。こ の様に作製した感光体を市販の複写機に装着して、コピ 一画像を調べた。実施例1と同様、泡由来の欠陥のない 良好な画像が得られた。結果を表1に示す。繰り返し特 性も良好であった。

【0037】比較例1

電荷移動層の塗布溶剤をテトラヒドロフラン318重量部、1,4ージオキサン(沸点101.4℃)171重量部の混合溶剤とした以外は、実施例1と同様に行った。この様に作製した感光体を市販の複写機に装着してコピー画像を調べたところ、泡由来の多数欠陥のある画像となった。結果を表1に示す。

【0038】比較例2

電荷移動層の塗布溶剤をテトラヒドロフラン391重量 部、ジメトキシメタン(沸点42.3℃)98重量部の 混合溶剤とした以外は実施例1と同様に行った。この様 に作製した感光体を市販の複写機に装着してコピー画像 を調べたところ、泡由来の多数欠陥のある画像となっ 9

た。結果を表1に示す。

上欠陥のない良好な画像が得られる。

【0039】以上の結果から明らかな様に本発明では、

【0040】 【表1】

乾燥工程で発生する泡由来の欠陥を抑制し、コピー画像 【表】

表 1

欠陥(泡)数/ドラム1本

| 実施的 | 列 1 | 0 |
|-----|-----|--------------|
| 11 | 2 | 0 |
| 11 | 3 | 0 |
| 11 | 4 | 0 |
| 比較的 | 列 1 | $10 \sim 20$ |
| " | 2 | $20 \sim 40$ |

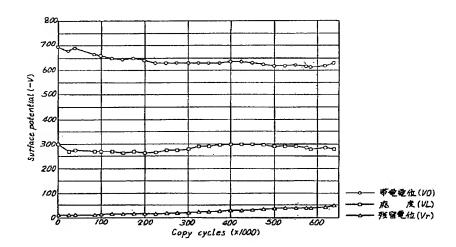
[0041]

【発明の効果】本発明方法によれば、塗布後の感光体の 乾燥工程において発生する泡由来の重大な欠陥を抑制さ せ、膜の摩耗および残留電位蓄積に由来する悪影響を最 小限に抑え、高品質且つ耐刷性にすぐれた電子写真感光 体を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1での繰返しサイクルにおける帯電電位 (V_c) 、残留電位 (V_r) 及び感度 (V_L) の変化

【図1】



フロントページの続き

(72) 発明者 臨 護

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三 菱化成株式会社総合研究所内